

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成22年11月25日(2010.11.25)

【公表番号】特表2003-523450(P2003-523450A)

【公表日】平成15年8月5日(2003.8.5)

【出願番号】特願2001-560322(P2001-560322)

【国際特許分類】

C 10 G	69/02	(2006.01)
C 10 G	29/06	(2006.01)
C 10 G	29/16	(2006.01)
C 10 G	45/08	(2006.01)

【F I】

C 10 G	69/02	
C 10 G	29/06	
C 10 G	29/16	
C 10 G	45/08	Z

【誤訳訂正書】

【提出日】平成22年10月4日(2010.10.4)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】請求項12

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【請求項12】

前記水素添加-脱硫は、150～400 の範囲の入口温度で、モリブデン酸コバルト及び／またはモリブデン酸ニッケルを含む触媒床を使用してもたらされる、請求項1～11のいずれか1項に記載のプロセス。

【誤訳訂正2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0010

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0010】

この前処理工程は、他の点で予備改質(pre-reforming)とも称されることが多い、断熱低温接触蒸気改質であってもよい。そのようなプロセスでは、蒸気を炭化水素供給原料に添加し、混合物を、典型的には、好適な担体上のニッケル、ルテニウム、プラチナまたはロジウムである低温改質触媒床に、300～600 、特に400～550 の範囲の入口温度で断熱的に通過させる。好ましい触媒は、共沈されるニッケル及びアルミニウム化合物を含有する組成物を還元される生成物である。還元される触媒は、好ましくは少なくとも40重量%、好ましくは少なくとも50重量%のニッケルを含有する。添加する蒸気の量は、前処理工程に供給される炭化水素流の一部の炭化水素炭素1グラム原子当たり蒸気0.5～3モルであるのが好ましい。触媒床を通す間、断熱蒸気改質が起きて、水素含有ガス流が得られる。